

Aka-Brief #8 钛合金

1



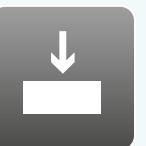
Piatto 220+



水



300 RPM



20 N



磨平



BF, 50x



BF, 50x



BF, 50x

2



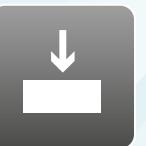
Allegran 3



DiaUltra
6 μ m



150 RPM



30 N



4 min



BF, 50x

3



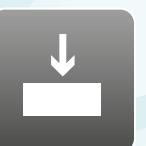
Chemal*



Fumed Silica
0.2 μ m
Alkaline**



150 RPM



25 N



5 min



图中所示时间与压力均适用于标准的300毫米制样系统和40毫米直径样品。

使用250毫米制样系统时，时间相应增加30%；使用200毫米制样系统时，时间相应增加 100%。

所使用的压力应随样品尺寸的增大和减小而进行相应的增大和减小。

样品夹/样品移动盘的转速为150转/分钟。

样品制备所需的时间和压力可能根据制样设备的不同而有所变化。

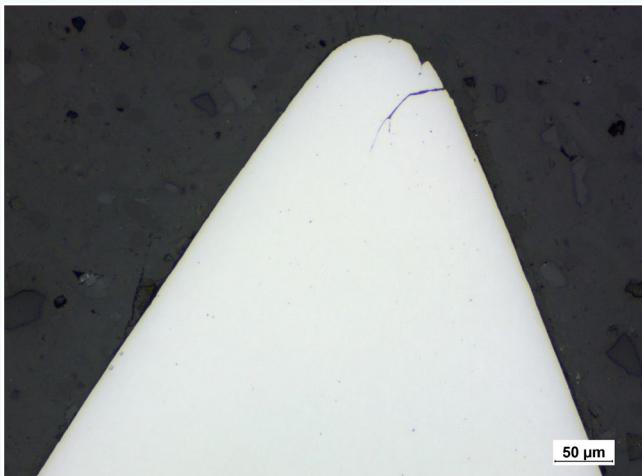
*开始氧化抛光之前，加水使整片抛光布湿透，样品夹/样品移动盘下移接触到抛光布时，停止加水。在氧化抛光的最后10秒，加水冲洗样品和抛光布。

**96毫升 Fumed Silica,
2毫升 H₂O₂ (30%),
2毫升 NH₄OH (25%).

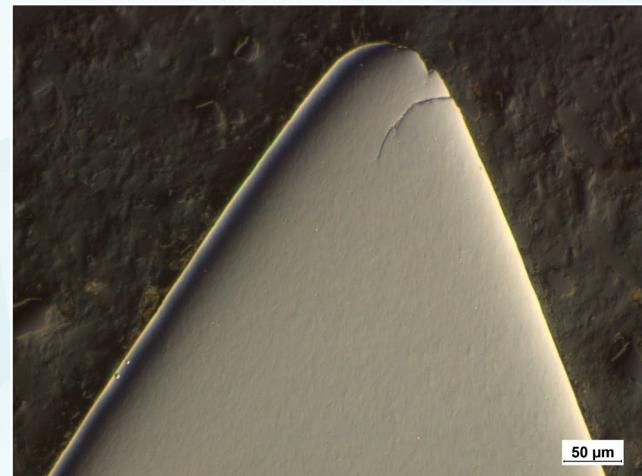
这种混合物应该在新鲜时使用（几个小时内），并定期搅拌。



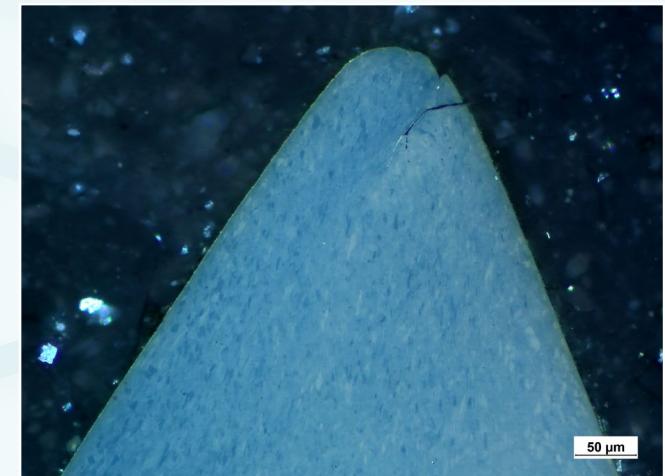
Aka-Brief #8 钛合金



TiAl4V



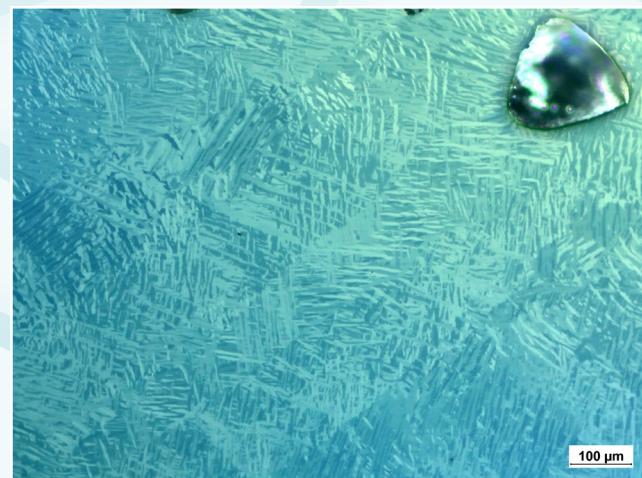
TiAl4V



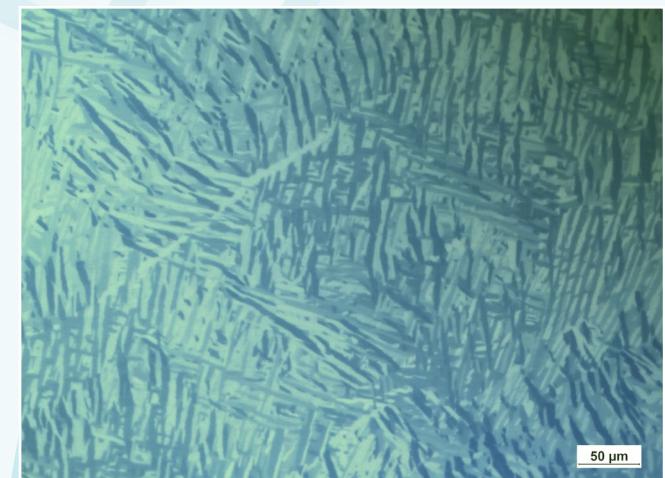
TiAl4V Z@UbVXU &SS



3DTiAl4V, 微分干涉衬度像, 100倍



3DTiAl4V, 偏正光+Lambda补偿片, 100倍



3DTiAl4V, 偏正光+Lambda补偿片, 200倍